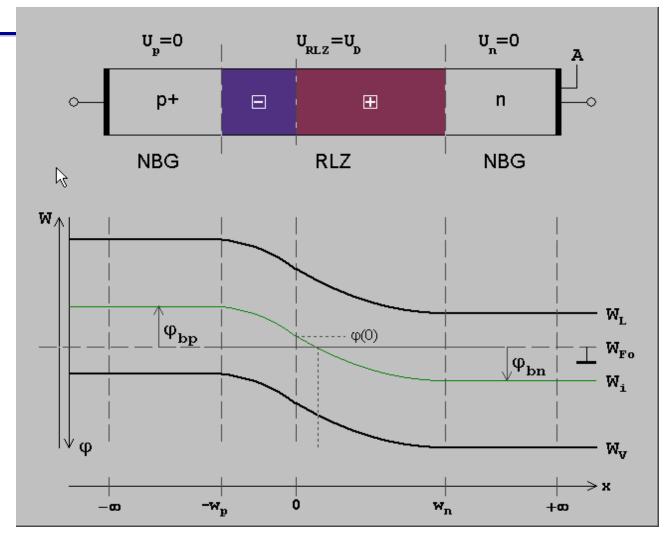
Übersicht über die Vorlesung

- 1. Grundlagen der Quantenmechanik
- 2. Elektronische Zustände
- 3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
- 4. Elektronen in Kristallen
- 5. Halbleiter
- 6. Quantenstatistik für Ladungsträger
- 7. Dotierte Halbleiter
- 8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
- 9. Der pn-Übergang

Festkörperelektronik SS 2015 12. Foliensatz 26.06.2015

Die pn-Diode



Für eine quantitative Modellierung der pn-Diode fehlt jetzt "nur" noch der Potentialverlauf und die Größe der Raumladungszone

Schottky-Modell der pn-Diode

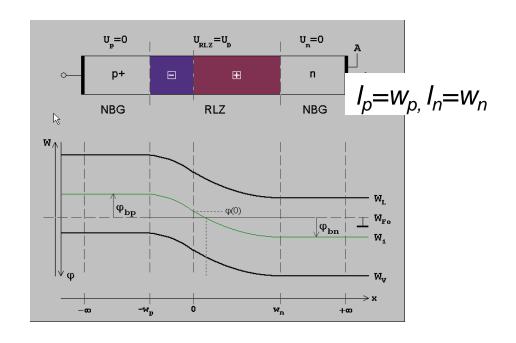
 Annahme: Räumlich abrupter Übergang von neutralen zu vollständig ionisierten Störstellen ^{+en}D</sub> Schottky-Näherung

$$\rho(x) = \begin{cases}
0 : x \le -I_p \\
-en_A : -I_p < x \le 0 \\
en_D : 0 < x \le I_n \\
0 : x > I_n
\end{cases}$$

 $\rho(x) = \begin{cases} 0 : x \le -I_p \\ -en_A : -I_p < x \le 0 \\ en_D : 0 < x \le I_n \\ 0 : x > I_p \end{cases}$ $N_{A(D)} : Dichte der Akzeptor- (Donator-) Atome$

Insgesamt Ladungsneutralität:

$$n_A \cdot I_p = n_D I_n$$



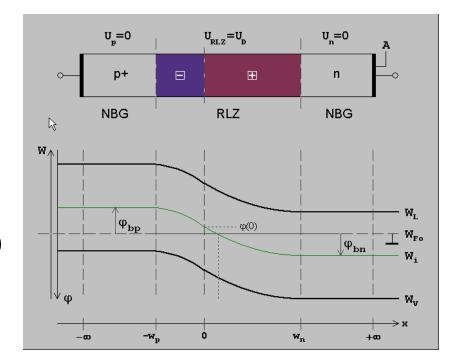
Berechnung des Bandverlaufs

Berechnung des Bandverlaufs durch Integration der Poisson-Glg.:

(H5)
$$\Delta \varphi = -\frac{\mathsf{e}}{\varepsilon \varepsilon_0} (p - n + n_D^+ - n_A^-); \ \vec{E} = -\nabla \varphi$$

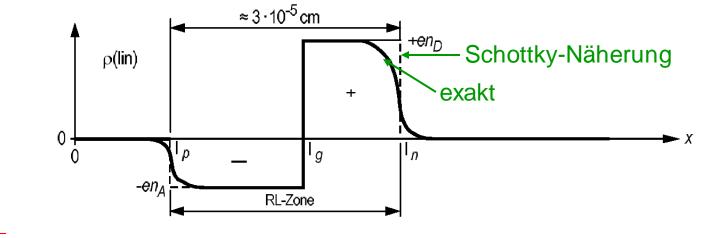
$$\rho(x) = \begin{cases} 0 : x \le -I_p \\ -en_A : -I_p < x \le 0 \\ en_D : 0 < x \le I_n \\ 0 : x > I_p \end{cases}$$

$$\frac{\partial^{2} \varphi(x)}{\partial x^{2}} = -\frac{\partial E(x)}{\partial x} = \frac{-1}{\varepsilon \varepsilon_{0}} \begin{cases} 0 : x \leq -I_{p} \\ -en_{A}:-I_{p} < x \leq 0 \\ en_{D}: 0 < x \leq I_{n} \\ 0 : x > I_{n} \end{cases}$$



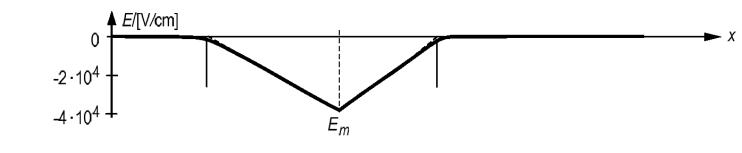
$$ho_p = -en_A$$

$$ho_n = en_D$$
 Schottky-Näherung



$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon_r \varepsilon_0}$$

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \qquad E(x) = -\frac{en_A}{\varepsilon_r \varepsilon_0} (x + l_p) \qquad E(x) = \frac{en_D}{\varepsilon_r \varepsilon_0} (x - l_n)$$



$$\varphi(x) = -\int_{x_0}^{x_2} E(x) dx - \varphi_0 \qquad \varphi(x) = \frac{en_A}{2\varepsilon\varepsilon_0} \left(x + I_p \right)^2 \quad | \qquad \varphi(x) = -\frac{en_D}{2\varepsilon\varepsilon_0} \left(x - I_n \right)^2 + U_D$$

$$U_D \approx 0.7 \text{ V für } U = 0$$

Berechnung des Bandverlaufs

$$W_{L}(x) = W_{L}(-\infty)$$

$$-e\varphi(x)$$

$$W_{V}(x) = W_{V}(-\infty)$$

$$-e\varphi(x)$$

$$W_{V}(x) = W_{V}(-\infty)$$

Für eine quantitative Beschreibung der Kennlinie und für das Ersatzschaltbild (insbesondere Kapazität) ist die Kenntnis der Ausdehnung I_p+I_n der Raumladungszone von großer Bedeutung. I_p und I_n sind allerdings bisher nur im Rahmen der Näherung Schottky-Modell als zusätzliche Parameter ins Spiel gekommen, ohne diese auf schon bekannte Halbleiterparameter zurückzuführen.

Die Ausdehnung kann aber nun berechnet werden. Hierzu wird die Ladungsneutralität ausgenutzt, sowie berücksichtigt, dass das elektrische Potential bei x=0 stetig sein muss:

Ausdehnung der RLZ

Ladungsneutralität: $n_D I_n = n_A I_p \Rightarrow I_p^2 = \frac{n_D^2}{n_A^2} I_n^2$ (4)

Für den Potentialverlauf im p- bzw. im n-Bereich wurden oben explizite Ausdrücke abgeleitet. Aus der Forderung nach Stetigkeit von $\varphi(x)$ an der Stelle x=0 folgt:

$$\frac{en_A}{2\varepsilon\varepsilon_0}I_p^2 = -\frac{en_D}{2\varepsilon\varepsilon_0}I_n^2 + U_D$$

Durch Ausnutzen der Neutralitätsbedingung (4) kommt man zu:

$$I_{n}^{2} \left(\frac{e n_{A}}{2 \varepsilon \varepsilon_{0}} \frac{n_{D}^{2}}{n_{A}^{2}} + \frac{e n_{D}}{2 \varepsilon \varepsilon_{0}} \right) = U_{D}$$

Auflösen nach I_n liefert dann:

$$I_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 U_D}{e} \frac{\frac{n_A}{n_D}}{n_D + n_A}}$$

Ebenso kann dann I_p bestimmt werden:

$$I_{p} = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_{0}U_{D}}{e} \frac{\frac{n_{D}}{n_{A}}}{n_{D} + n_{A}}}$$

Ausdehnung der RLZ

Die Gesamtausdehnung der Raumladungszone ergibt sich dann als Summe der einzelnen Breiten der RLZs:

Mit ein bisschen Bruchrechnung kommt man zu:
$$I = I_p + I_n = \dots = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 U_D}{e}} \sqrt{\frac{1}{n_D} + \frac{1}{n_A}}$$

Generell gilt also, dass die RLZ umso dünner ist, je stärker die Dotierung der Halbleitermaterialien ist.

Die nachfolgende Tabelle gibt einige konkrete Zahlenwerte für gängige Halbleitermaterialien an.

Ausdehnung der Raumladungszone

Die Gesamtausdehnung der RLZ ist:

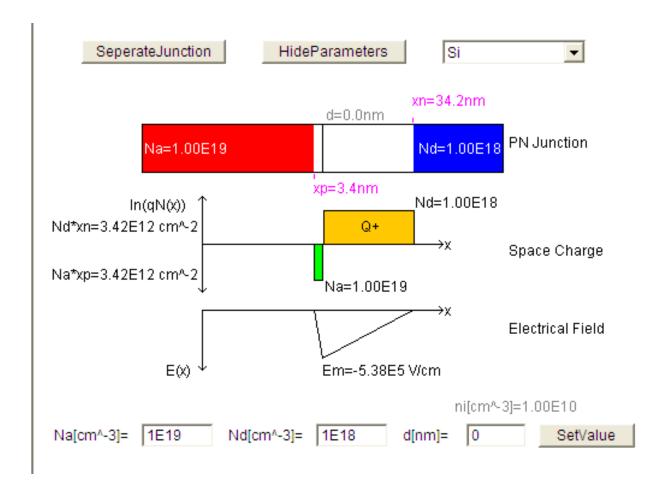
$$l = l_p + l_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0}{e}} U_D \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_D}\right)$$

 Die Ausdehnung teilt sich wie folgt auf den n-HL und den p-HL auf:

$$l_p = l \frac{n_D}{n_A + n_D} \quad l_n = l \frac{n_A}{n_A + n_D}$$

- Je nach Dotierung betragen die Ausdehnungen wenige Nanometer bis zu Mikrometern.
- Ist ein HL wesentlich schwächer dotiert als der andere, befindet sich die RLZ fast ausschließlich im schwach dotierten HL.

T = 300 K	Ge	Si	GaAs
$arepsilon_r$	16	11, 9	13,1
n_A/cm^{-3}	10^{15}	10^{15}	10^{15}
n_D/cm^{-3}	10^{15}	10^{15}	10^{15}
U_D/V	0, 18	0,56	1,0
$l_p/\mu\mathrm{m}$	0, 4	0, 6	0,85
$l_n/\mu\mathrm{m}$	0, 4	0,6	0,85
n_A/cm^{-3}	10^{15}	10^{15}	10^{15}
$n_D/{ m cm}^{-3}$	10^{18}	10^{18}	10^{18}
U_D/V	0,36	0,73	1, 18
$l_p/\mu\mathrm{m}$	0,8	1	1,3
$l_n/\mu\mathrm{m}$	0,0008	0,001	0,0013
n_A/cm^{-3}	10^{18}	10^{18}	10^{18}
$n_D/{ m cm}^{-3}$	10^{18}	10^{18}	10^{18}
U_D/V	0,53	0, 9	1,35
$l_p/\mu\mathrm{m}$	0,02	0,02	0,03
$l_n/\mu\mathrm{m}$	0,02	0,02	0,03



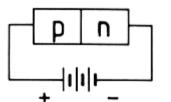
Der pn-Übergang bei Vorspannung

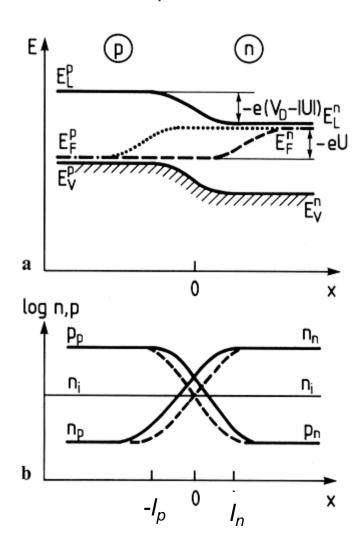
Qualitatives Verhalten:

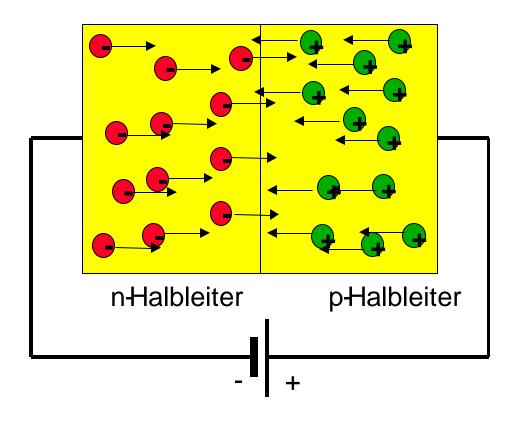
-Vorwärtsspannung "schiebt" Ladungsträger in RLZ hinein

-Spannung U führt zur Aufspaltung des Ferminiveaus in zwei Quasi-Fermi-Niveaus

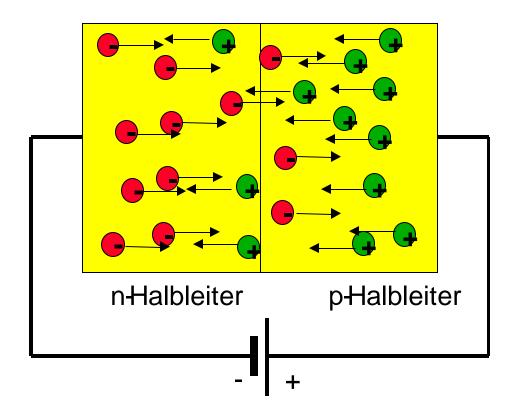




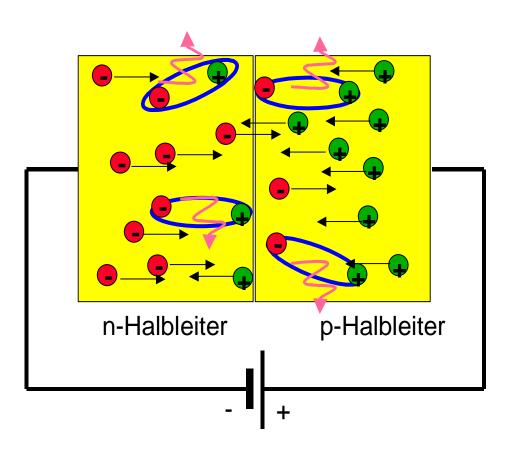




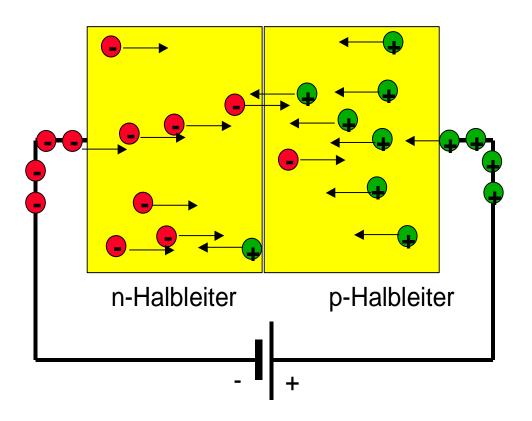
Polung in Vorwärtsrichtung: Elektronen und Löcher bewegen sich aufeinander zu



Polung in Vorwärtsrichtung: Elektronen diffundieren in den p-Halbleiter und Löcher in den n-Halbleiter



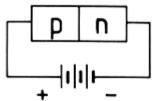
Polung in Vorwärtsrichtung: Elektronen rekombinieren mit Löchern und können z.B. Licht aussenden

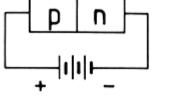


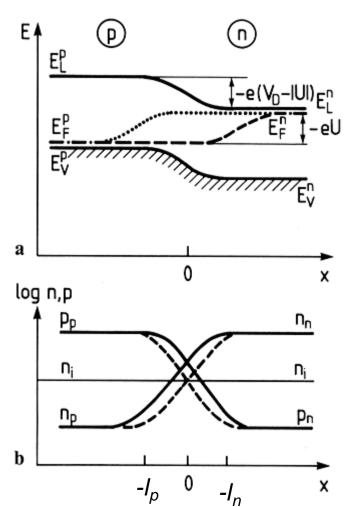
Polung in Vorwärtsrichtung: Fehlende Elektronen im n-Halbleiter und fehlende Löcher im p-Halbleiter fließen nach.

Durchlaßrichtung

Der pn-Übergang bei Vorspannung







Shockley-Modell:

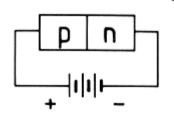
-Rekombination in der RLZ ist vernachlässigbar

-Stromfluß durch Änderung der Minoritätsladungsträgerdichten an den Rändern der RLZ

Feldströme brauchen nicht betrachtet werden, denn gerade außerhalb der RLZ ist das Feld und damit der Feldstrom = Null.

Durchlaßrichtung

Der pn-Übergang bei Vorspannung



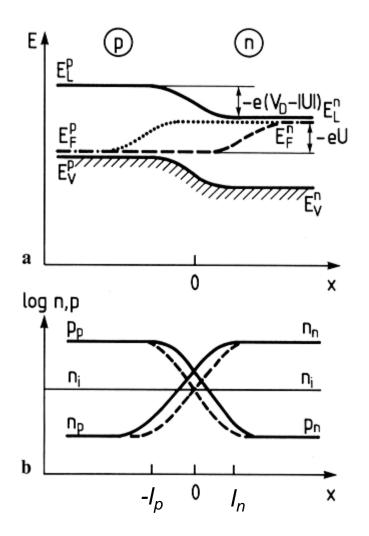
z.B. Löcherdiffusionstrom am rechten Rand der RLZ:

$$J_{\rho,D}(x=I_n) = -eD_{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial x}\Big|_{x=I_n}$$

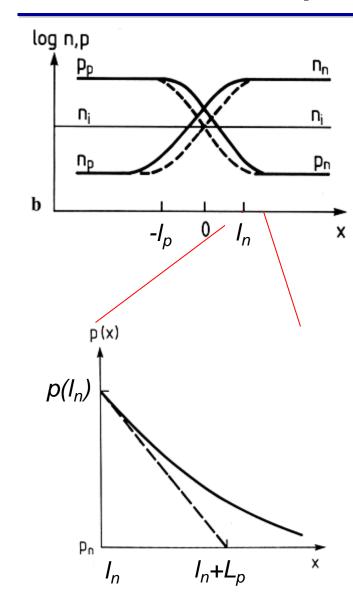
D.h. aus der Kenntnis von $p(x=l_n)$ kann der Diffusionsstrom abgeleitet werden

Für die Ortsabhängigkeit der Lochdichte gilt

$$p(I_n) = N_V \exp\left(-\frac{W_F + e(U_D - U) - W_V(-\infty)}{kT}\right)$$
$$= p_n \exp\left(\frac{eU}{kT}\right)$$



Der pn-Übergang bei Vorspannung



→ durch die geringere Potentialbarriere wird eine Überschussladungsträgerdichte von Minoritätsladungsträgern erzeugt

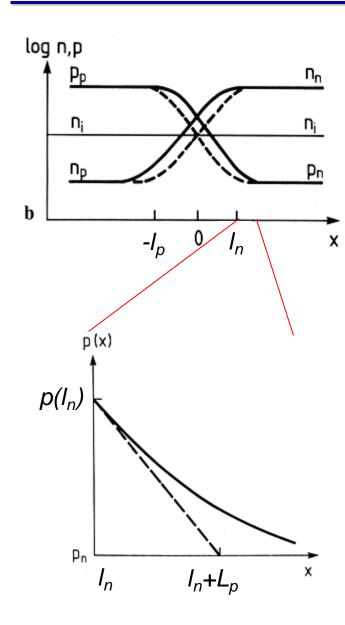
Diese beträgt:

$$\Delta p(I_n) = p(I_n) - p_n = p_n \left(\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right)$$

Dies führt zur Ausbildung eines Überschuss-Dichteprofils gemäß : (Übung)

$$\Delta p(x) = \Delta p(I_n) \exp\left(-\frac{x - I_n}{L_p}\right)$$
$$= \Delta p(I_n) \exp\left(-\frac{x - I_n}{\sqrt{D_p \tau_p}}\right)$$

Der pn-Übergang bei Vorspannung



- dies wiederum erhält einen Diffusionsstrom aufrecht gemäß

$$J_{\rho,D}(I_n) = -eD_{\rho} \frac{\partial}{\partial x} \left[\Delta \rho(I_n) \exp\left(-\frac{x - I_n}{L_{\rho}}\right) \right]$$
$$= e \frac{D_{\rho}}{L_{\rho}} \rho_n \left(\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right)$$

Eine analoge Betrachtung für die Elektronen ergibt:

$$J_{n,D}(-I_p) = -eD_n \frac{\partial}{\partial x} \left[n(I_p) \exp(-\frac{(I_p - x)}{L_n}) \right]$$
$$= e\frac{D_n}{L_n} n_p \left(\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right)$$

Diodenkennlinie

Insgesamt ergibt sich damit die folgende Kennlinie:

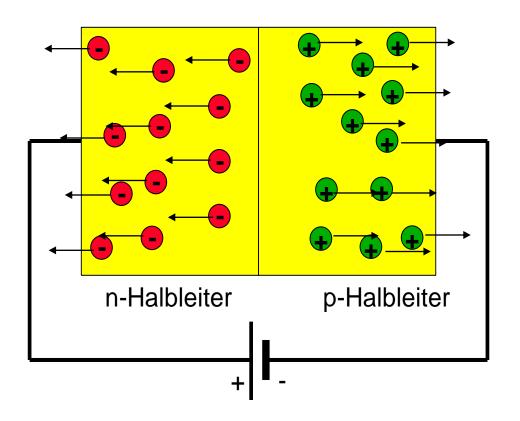
$$J(U) = e^{\left(\frac{D_n}{L_n} n_\rho + \frac{D_\rho}{L_\rho} p_n\right)} \left(\exp(\frac{eU}{kT}) - 1\right)$$

- exponentieller Anstieg in Vorwärtsrichtung

... und in Sperrrichtung?

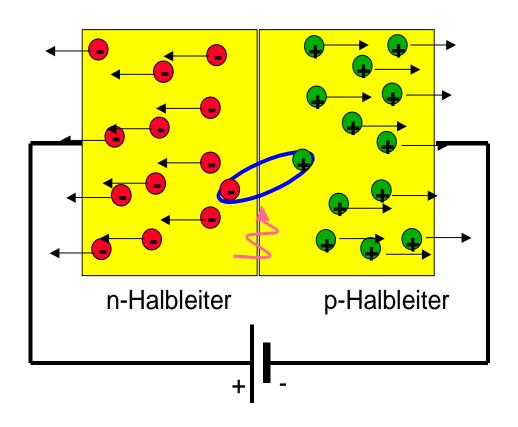
... die Formel bleibt richtig, nur U wird negativ.

pn-Übergang in Sperrrichtung



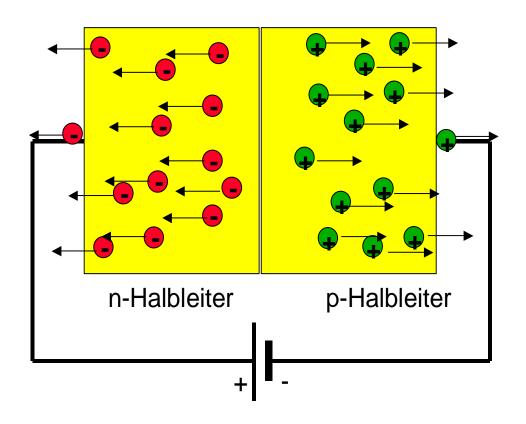
Polung in Sperrrichtung: Elektronen und Löcher bewegen sich voneinander weg.

pn-Übergang in Sperrrichtung



Polung in Sperrrichtung: Bei endlicher Temperatur können wenige Elektronen-Loch-Paare generiert werden, so dass wenige Ladungen von der Grenzfläche her nachfließen können.

pn-Übergang in Sperrrichtung



Polung in Sperrrichtung: Durch die nachfließenden Ladungen kann ein geringer Strom durch die pn-Diode fließen.

Diodenkennlinie

Insgesamt ergibt sich damit:

$$J(U) = e^{\left(\frac{D_n}{L_n} n_p + \frac{D_p}{L_p} p_n\right)} \left(\exp(\frac{eU}{kT}) - 1\right)$$

- exponentieller Anstieg in Vorwärtsrichtung
- schnelle Sättigung in Rückwärtsrichtung

